

# 离子辅助沉积中离子束流密度的作用

张大伟, 洪瑞金, 范树海, 王英剑, 邵建达, 范正修

中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800

收稿日期 2004-1-7 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 测量了End-Hall离子源在不同条件下的离子束流密度, 在不同离子束流密度下进行了Ar离子辅助沉积ZrO<sub>2</sub>薄膜的实验, 研究了离子束流密度对薄膜折射率、晶相的影响. 根据动量传递模型分析了离子束流密度对薄膜折射率的作用; 根据热尖峰理论证明了一定条件下离子束流密度不会影响薄膜晶体结构.

关键词 [离子辅助](#) [离子束流密度](#) [热尖峰](#) [晶相](#)

分类号

通讯作者 [dwzhang@opfilm.com](mailto:dwzhang@opfilm.com)

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(219KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ 本刊中 [包含“离子辅助”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [张大伟](#)
- [洪瑞金](#)
- [范树海](#)
- [王英剑](#)
- [邵建达](#)
- [范正修](#)